



## 儀器設備管理辦法

### 一、儀器名稱

中文：原子層沉積系統

英文：Atomic Layer Deposition system

### 二、儀器設備廠牌及型號

高敦科技公司, KD-ALD

### 三、功能說明

以原子層沉積方式至被氧化鋅(ZnO)、氧化鋁鋅(AlZnO)、氧化鎂鋅(MgZnO)、氧化鋁(Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>)、氧化鎂(MgO)等薄膜。基板溫度可調變範圍為 75 °C-400 °C；本系統亦有遠端電漿源，可調控瓦數為 (100 W-400 W)，其可用電漿氣體源為氬氣與氧氣。

### 四、自行操作規則

1. 本系人員經過認證之後，即可使用儀器。
2. 儀器為本系公用設備，原則上不開放外系人員使用。若外系人員欲使用此公用儀器，經機台負責教師同意，及機台負責人認證，始可操作儀器。
3. 申請注意事項  
請申請人確認於近期（半年）內會使用此機台，並長期使用之狀態下在報名訓練課程。

### 五、預約及管理辦法

1. 欲取得使用資格需先向機台負責教師提出申請，或由其指定的儀器助教提出申請，領取申請表格，經由儀器助教教學指導，完成訓練且由儀器負責人(或助教)核可認證，即可使用公用儀器。
2. 認證項目為儀器之基本操作，核可認證之後，**1 個**禮拜後儀器負責人(或助教)會將通過認證之名單繳交系辦，系辦將開啟此單機權限，此時使用者(B 級)將可預約使用。
3. 每次預約以小時為單位，以 **6 小時**為限，使用時間過後方可預約下次時間。請於預定使用日前 **1 週**至系辦預約登記，若臨時欲取消預約者需在使用前兩日取消預約。
4. 開放時間：**每周二至四，早上 8:00~晚上 8:00**。
5. 使用儀器請依預定時間確實報到使用，若因故無法依預定時間使用，又無事先預約取消者，停權一個禮拜。

### 六、罰責

1. 本儀器之使用，只限通過認證者，一經發現無核可認證者使用儀器，將連帶停止其所屬實驗室使用權 **1 個月**。

2. 使用儀器前，需事先預約使用時段。
3. 儀器每次之使用，必須確實填寫儀器使用記錄簿，確認並載明儀器使用前後之狀況。遇有儀器異常狀況，需停止使用、記載、並立刻通知儀器負責人。儀器使用記錄簿需隨時置於儀器旁，不得毀損。
4. 經發現因個人因素造成儀器或其配件如有損毀，需由使用者之實驗室負責賠償。
5. 儀器開機和關機時，請依標準操作流程操作，且於儀器使用完後，保持儀器之清潔和清理操作台面，並將實驗廢棄物帶走。違反規定者，經確認後將由通知日起暫停使用者所有使用權限 **1 個月**。
6. 儀器負責人有權修改機台內製程參數，非儀器負責人不得修改。如需調整製程參數，請於使用前 **2 日**與儀器負責人通知連絡，由儀器負責人做製程參數修改，違反規定者，經確認後將由通知日起暫停使用者所有使用權限 **1 個月**。
7. 儀器負責人有權定時清除機台內製程參數，刪除用戶數據資料，以確保磁碟空間足敷後續人員使用，故於每次實驗完畢請將個人實驗數據做記錄，一但經由儀器負責人刪除概不負責。
8. 未按時記錄操作狀況者，停止使用 **2 個星期**。
9. 實驗室內不得攜帶任何食物及飲料進入，第一次予以警告，第二次予以停權 **2 個星期**。

#### 七、聯絡人

機台負責教師：李欣縈 教授(hylee@ee.ncku.edu.tw)

機台負責人：林渝璋 0937768624 (yuchang1988@gmail.com)

#### 八、其它部份，則依本系管理規範為原則。